

**C25 PROCESOS ELECTROLITICOS O ELECTROFORETICOS; SUS APARATOS [4]****C25F PROCESOS PARA LA ELIMINACION ELECTROLITICA DE MATERIA EN OBJETOS; SUS APARATOS** (tratamiento del agua, agua residual o de alcantarilla por procesos electroquímicos C02F 1/46; protección anódica o catódica C23F 13/00) [2]**Nota**

En la presente subclase, salvo indicación en contra, una invención está clasificada en el último lugar apropiado. [2]

<b>1/00</b>	<b>Limpieza, desengrasado, decapado o descascarillado por vía electrolítica [2]</b>	<b>3/12</b>	. . de materiales semiconductores [2]
<b>1/02</b>	. Decapado; Descascarillado [2]	<b>3/14</b>	. . Localmente [2]
<b>1/04</b>	. . en solución [2]	<b>3/16</b>	. Pulido [2]
<b>1/06</b>	. . . de hierro o acero [2]	<b>3/18</b>	. . de metales ligeros [2]
<b>1/08</b>	. . . de metales refractarios [2]	<b>3/20</b>	. . . de aluminio [2]
<b>1/10</b>	. . . de actínidos [2]	<b>3/22</b>	. . de metales pesados [2]
<b>1/12</b>	. . en baños fundidos [2]	<b>3/24</b>	. . . de hierro o acero [2]
<b>1/14</b>	. . . de hierro o acero [2]	<b>3/26</b>	. . . de metales refractarios [2]
<b>1/16</b>	. . . de metales refractarios [2]	<b>3/28</b>	. . . de actínidos [2]
<b>1/18</b>	. . . de actínidos [2]	<b>3/30</b>	. . de materiales semiconductores [2]
<b>3/00</b>	<b>Grabado o pulido electrolítico [2]</b>	<b>5/00</b>	<b>Levantado electrolítico de capas o revestimientos metálicos [2]</b>
<b>3/02</b>	. Grabado [2]	<b>7/00</b>	<b>Elementos estructurales, de células o sus ensambles para la eliminación electrolítica de materia en objetos</b> (tanto para revestimiento como para eliminación electrolíticos C25D 17/00); <b>Operación o servicio [2]</b>
<b>3/04</b>	. . de metales ligeros [2]	<b>7/02</b>	. Regeneración de los baños [2]
<b>3/06</b>	. . de hierro o acero [2]		
<b>3/08</b>	. . de metales refractarios [2]		
<b>3/10</b>	. . de actínidos [2]		